

GERSTEL TDU2 加熱脱着システム

GERSTEL K.K.

GC-MS 分析のワークフロー



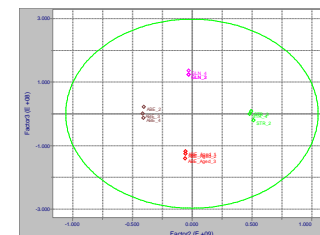
- ・簡易化
- ・自動化
- ・省溶媒
- ・網羅性

- ・揮発性成分
- ・大量注入
- ・汎用性
- ・自動化

- ・高分離能
- ・高速化
- ・多次元化

- ・高感度
- ・高選択的
- ・官能的

- ・定性、定量
- ・網羅的解析



GC-MS分析のワークフローは、5つのステップに分けることができます。
 精度の高い分析を行う為には、各ステップにおいて最適な技術を選択することが重要です。

GC-MS 分析のワークフロー



SBSE
SA-SBSE



DHS

TDU



CIS4



GC-O/MS
1D/2D-GC-O/MS



ODP4



におい嗅ぎ/
分取GC

Aroma Office 2D



Aroma Office 2D

GERSTEL社では、各ステップにおいて独自の最新技術を開発しており、目的に合わせて最適の技術を選択して、それらを自在に組み合わせてソリューションシステムを構成することができます。

GERSTEL TDU2 加熱脱着システム

前処理
(抽出・濃縮)

試料導入

- ・簡易化
- ・自動化
- ・省溶媒
- ・網羅性

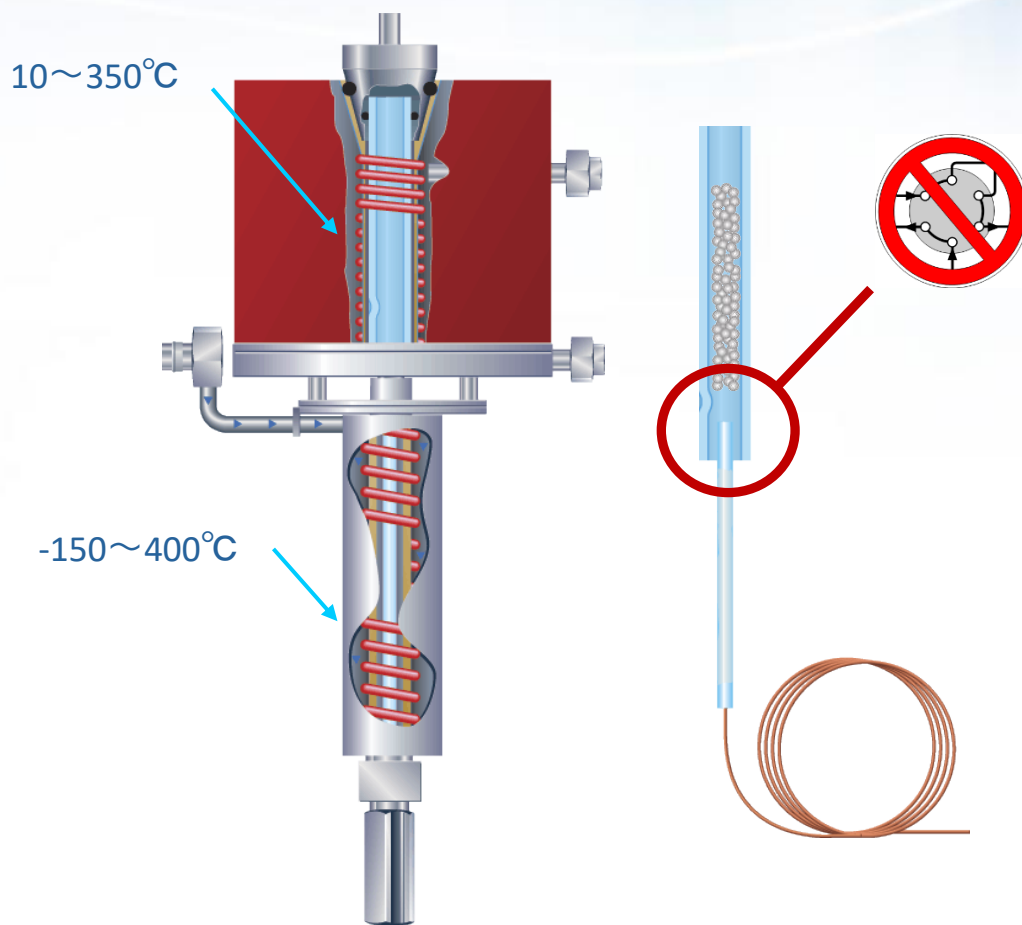
- ・揮発性成分
- ・大量注入
- ・汎用性
- ・自動化



GERSTEL TDU2

GERSTEL社装置群の中で中心となるのが、GERSTEL TDU2加熱脱着システムになります。TDU2は小型の加熱脱着装置の機能に加えて、3軸ロボット型オートサンプラMPS robotic/robotic^{pro}との組み合わせにより、各種前処理の自動化、ミニチュア化を実現し、分析の高感度化/高精度化、分析プロセス全体の効率化に貢献します。

GERSTEL TDU2の特長



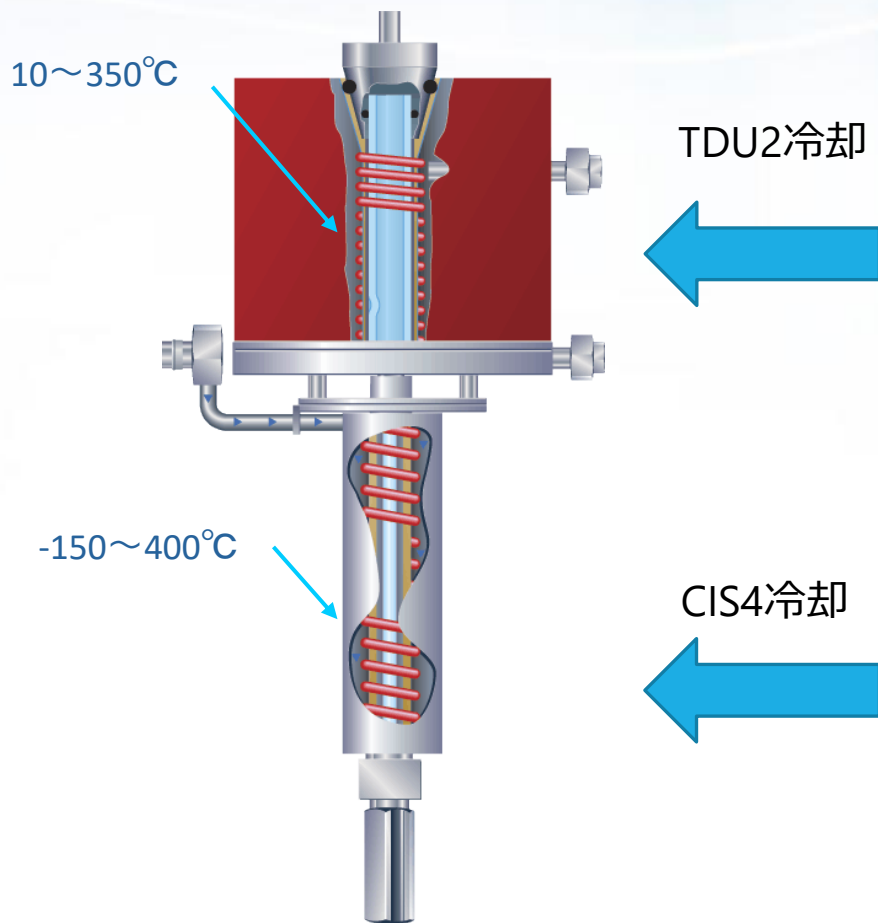
- ・バルブレス構造
- ・トランスファーライン無し
- ・コールドスポットが無し
- ・キャリアーガスはEPC制御



極性成分やSVOC成分が
吸着せず再現性良く
分析可能

TDU2はクライオフォーカス部CIS4と直結しており、「バルブレス」、「トランスファーライン無し」の構造のため、「コールドスポットの問題」を解消しています。キャリアガス制御は、アジレント社GCで定評のあるEPC制御を採用しており、極性成分/SVOC成分等の吸着の問題やコンタミネーションを最小限に抑える優れた設計となっています。

GERSTEL TDU2の特長



UPC Plus(標準)



液体窒素
-150°C~



CCD2
-40°C~



UPC Plus
10°C~

クライオフォーカス部CIS4の冷却は、3種類のオプション(液体窒素、CCD2、UPC Plus)より、対象成分やランニングコストなど使用目的に合わせて選択可能です。

TDU2の特長 —各種試料前処理・導入技術—

GERSTEL



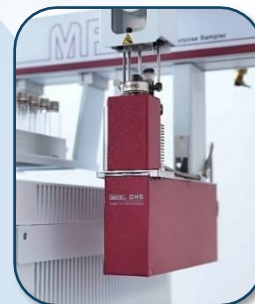
ATEX/直接導入



Twister/FLEX-Twister



大量注入



DHS/DHS Large



吸着剤



HIT-HS/SPME/SPME Arrow



PYRO オプション



TDU2は多様な試料前処理・導入技術に対応した加熱脱着装置型のシステムです。試料の形態、マトリックス、対象成分、濃度範囲などに合わせて最適な手法を選択することが可能です。

詳細については、バーチャルアプリケーションラボに
ユーザー登録の上、TDU2の製品紹介をご覧ください

<https://gerstel.jp/Exhibition/>

GERSTEL

バーチャルアプリケーションラボ
開催中！

